

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 7 月 28 日(28.07.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/090216 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/225 (2006.01) H01L 31/04 (2006.01)
C03C 8/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/051367
- (22) 国際出願日: 2011 年 1 月 25 日(25.01.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-013517 2010 年 1 月 25 日(25.01.2010) JP
特願 2010-208429 2010 年 9 月 16 日(16.09.2010) JP
特願 2011-005313 2011 年 1 月 13 日(13.01.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (Hitachi Chemical Company, Ltd.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 町井 洋一 (MACHII, Youichi) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台 4 8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 吉田 誠人 (YOSHIDA, Masato) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台 4 8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 野尻 剛 (NOJIRI, Takeshi) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台 4 8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 岡庭 香 (OKANIWA, Kaoru) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台 4 8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 岩室 光則 (IWAMURO, Mitsunori) [JP/JP]; 〒3004247 茨城県つくば市和台 4 8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 足立 修一郎 (ADACHI, Shuuichirou) [JP/JP]; 〒3004247 茨城

県つくば市和台 4 8 日立化成工業株式会社内 Ibaraki (JP). 青柳 拓也 (AOYAGI, Takuya) [JP/JP]; 〒3191292 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 株式会社日立製作所 日立研究所内 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 膝舘 祥治, 外 (HIZATATE, Shoji et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿 4 丁目 3 番 1 7 号 H K 新宿ビル 7 階 太陽国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: n-TYPE DIFFUSION LAYER FORMING COMPOSITION, METHOD FOR MANUFACTURING n-TYPE DIFFUSION LAYER, AND METHOD FOR MANUFACTURING SOLAR CELL

(54) 発明の名称: n 型拡散層形成組成物、n 型拡散層の製造方法、及び太陽電池セルの製造方法

(57) Abstract: Disclosed is an n-type diffusion layer forming composition which contains: a glass powder containing a donor element; and a dispersion medium. An n-type diffusion layer, and a solar cell having the n-type diffusion layer are manufactured by applying the n-type diffusion layer forming composition and performing heat diffusion treatment.

(57) 要約: 本発明の n 型拡散層形成組成物は、ドナー元素を含むガラス粉末と、分散媒と、を含有する。この n 型拡散層形成組成物を塗布し熱拡散処理を施すことで、n 型拡散層、及び n 型拡散層を有する太陽電池セルが製造される。



WO 2011/090216 A1